

## (322) Tin Free Steel メッキ浴濃度連続測定法の開発

新日本製鐵(株) 基礎研究所 ○鈴木良一, 松本龍太郎

## 1. 緒 言

Tin Free Steel (TFS) メッキ浴中の Cr(VI), Cr(III) 濃度はクロム付着量や表面性状に大きな影響を及ぼす。浴の安定化による品質の向上を目的として、浴濃度を自動管理するために連続測定法を検討し、二波長吸光光度法による方法、および装置を開発し、満足に測定できることが認められたので報告する。

## 2. 実験および結果

(1) Cr(VI) 濃度の測定 浴濃度そのままでは定量可能な特性吸収帯が得られないで、浴を  $1/50$  に希釈して測定を行った。その結果、図 1 のように  $440\text{ nm}$  と  $560\text{ nm}$  の吸光度差  $\Delta A$  を測ることによって、共存成分およびセルの汚れに基づく吸収を相殺して Cr(VI) による吸光度が求められることがわかった。この  $\Delta A$  と Cr(VI) との間に直線性の良い検量線が得られ、また、共存成分の影響は無視できるほど小さいものであった。

(2) Cr(III) 濃度の測定 Cr(III) の吸収スペクトルは、図 2 のように  $600\text{ nm}$  付近に最大吸収を有する。ところが、Cr(VI) が共存すると Cr(VI) の吸収帯の裾の部分と重なり、明瞭な特性吸収帯とはならない。しかしながら  $620\text{ nm}$  付近の吸収は Cr(III) に基づくものであり、セルの汚れなどによる誤差を除くために近接する  $700\text{ nm}$  との吸光度差  $\Delta A$  から求める方法をとった。その結果、 $\Delta A$  と Cr(III) 濃度との間で良い直線関係が得られ、また共存成分の影響は非常に小さいことが認められた。

## 3. 濃度測定システムおよび装置

浴をまず Cr(III) 測定用の二波長分光器に導き、Cr(III) 濃度を測定し、つぎに連続希釈装置によって  $1/50$  に希釈し、Cr(VI) 測定用の分光器に導き Cr(VI) 濃度を測定する。本測定システムのために、気泡、異物等がプローセル中を通過しても吸光度に与える影響が小さく、また、光学系や検出器・電気系統の変化の影響が小さく、長期安定性の良い二波長分光器を開発した。装置の概要は写真 1 のようになっている。

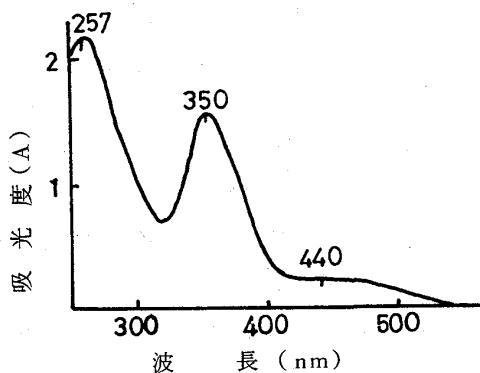


図 1. Cr(VI) 吸収スペクトル

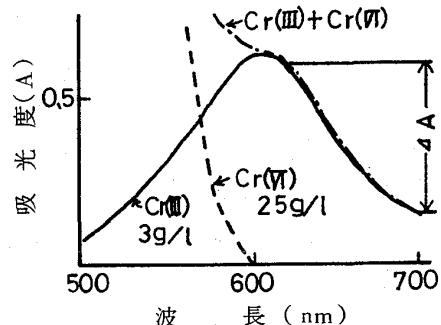


図 2. Cr(III) 吸収スペクトル



写真 1. 装置の概要